## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—84342

⑤Int. Cl.<sup>3</sup> G 01 N 27/16 識別記号

庁内整理番号 6928-2G ③公開 昭和57年(1982)5月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂ガス検知素子の製造方法

②特

願 昭55-160209

(22) H1

顧 昭55(1980)11月14日

⑩発 明 者 宮口耀一郎

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

②発 明 者 間中順二

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

72発 明 者 塩原淳一

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑫発 明 者 戸田伸一

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

⑭代 理 人 弁理士 小橋正明

明 稚 書

1. 発明の名称

カス検知素子の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 母線上に予め速定された少なくとも1 懂の 金属を含有する被獲騰を付着形成する第1工 位、加熱迅速により前記被獲騰を少なくとも 部分的に合金化する第2工程、前記被穩層の 少なくとも外表面を酸化物層とする第3工程、 前記酸化物層を部分違元して触媒賦活化層と する第4工程、を有するガス策知案子の表直 方法。
- 3. 光明の詳細な説明

本発明は特定のカスの存在下においてその電気 的特性の変化を生じ、ガスの存在を検知可能なガ ス映知素子の製造方法に興するものである。

近年、可然在ガス、毒性ガス等の危険性の高いカスの漏機や濃度を恢知する必要性から種々のガスセンサが開発されており、動作原理の面から大別すると、接触燃焼式センサ、熱伝導度式センサ、

半導体式センサ等に類別される。本発明は接触燃焼式センサに属するものであつて、接触燃焼式センサは、接触燃焼業子として通常白金線コイルを母線としその同囲に日金やパラジウムを主成分とする触媒を被獲したピード状の差子で、特定ガス(通常は可然性ガス)の仔圧により按触燃焼を起こせ、そのときの発熱により日金級コイルに生じる抵抗値変化を電気的に取り出してガス検知するものである。この場合にこの様な者子を2個使用してブリッシ回路を構成するのが普遍である。

(2)

慮して判断されればならない。従つて、接触燃焼式素子の全体的カス感度特性を改善する埋想的方法は、素子の形状を小型とし熱容量を展少させて熱心容特性を同上させると共に素子の電気的特性、即ち低抗値変化の応答特性を同上させるものでなければならない。

ると、別3工程においてこれらの金属を酸化物とした場合にミクロ的構造が多孔性となつているのでガスの侵逃性が良く、従つて接触面積がそれだけ実質的に増加されたことを意味し、検知機度が向上する。

(3)

更に、本製 1万法によつて製造されたガス検知 素子は高感度である為従来技術の如くコイル状に する必要がなく、 1 対の電優ステム間に直線的に 取り付けて使用することが可能である。 これは、 同一距離間において使用される素子体横は本発明 による場合更に小さくなり、 これは材料の節約の みならず熱容量のは下にも寄与する。

以下、図面を参考に本光明の実施態隊に付き記明する。用1図は本発明の契道方法で製造したガス検知来子1を1対のステム2,2上に収り付けた状態を示している。ステム2,2は絶縁材料から作られた支持体3に支持されており、又素子1を包囲する看火防止用の防爆ネット4が設けられている。上述した如く、本光明の製造方法により製造されたガス吸用業子1は極めて高級度であり、

においてその特性が悪影響を受けることなく、完成品においても高熱抵抗温度特性を発揮可能である。このことは母級にPt 又はPt 合金を使用した場合にはそれらの優れた電気的、化学的特性を完成品として享受可能であることを示している。 尚、母級としてはPt、Pt合金に限られるものではなく同等の特性を有する多種金属を使用可能なことはの論である。

父、本発明では母線上に所定の金属を含有する被機層を付着形成させ、加熱処理して少なくとも付着前近傍を台金化させて一体化しているので被後着は強固に母線に付着され機械的短度は必めて高い。続いて、本発明では破後層の少なくとも外表面を酸化・激元処理してコンデイショニンクしその部分での估性化エネルギ状態を低くつとしてを触燃のして、本発明の触燃に関を向上させている。使ってもり、その熱容量は極めて小さいので、熱にさてもり、その熱容量は極めて小さいので、熱にさせたが著しく改善されていることが分かる。尚、選定金属として、例えば、TiやAℓ等を使用す

コイル状にすることなくステム 2 , 2 間に直線状に取り付けるだけで良い。 ぼつて、 本発明によれば熱谷量は悪小化されており、 その点でもガスセンサ 5 としてのガス検知感度が同上されることが分かる。 足に、 悔遠的にも小型軽量となるので、 案子 1 目体の変形の可能性は解消され、 機械的特性の安定化及びそれに起因する性能変動の不存在等の効果がある。

(4)

(6)

Ni、In、Pd、Al、Pt、Sn、Zn、Fe、及びCo **等から選定することが可能であり、これらの金属** の1 種父は2 種以上を送定して、電看法、スパッ タ伝、蒸煮法、無電解メッキ法等の公知技術を便 用して層形成可能である。被積層11は単層では なく多層 (例えば、3 種の金属を選足した場合に は3層とする如く)とすることも可能である。尚、 Pt とSn 父はZn との複合化台物はガス心容感 度が高いので (Sn、Zn は助触媒として作用する)、 これらの金属を同時に皮用することが望ましい。 一万、上掲のグループの金属の他に、T102、 ZrU2、Aℓ2U3、SiU2 等の金属酸化物を破機 層11円に分散させることも可能であり、この場 台に、然看法を使用する場合には高周波スパッタ 等により、又電者法による場合には電解液の懸濁 分散 (分散剤を含む) によつて被獲 書11内に分 敬させると良い。被復層 1 1 の厚さは 0.5~10 μm 程度とすると良く、例えは直径20 μm のとt 母 親10亿対し、Cu、Zn、Aℓ、Pt 等の場合には 500A 程度 とし、 Sn、Fe、Pd等の場合には1,000A

(7)

導性が大である。

次いで、第2凶D)に示す如く、酸素を30~40 第含有する券曲気中で徐々に加熱処理して破役順 11の少なくとも外表面に酸化物増13を形成す る。気体中で酸化する代わりに化学処理によつて 酸化することも可能である。この酸化物槽13は 外表面近傍のみならず所異の米さに達する迄、例 えは母親10に達しその1部を酸化物とする保さ まで仕意の厚さに形成可能である。この処理によ つて、表面には復合酸化物や金属酸化物の多結晶 体が認められ、かつその内側には金属リッチの額 化物瘤 ( ) A は S n O 2 - x 、 Z n O 1 - x 、 C u S n O 3 - x 等)が存在する為に、自由電子が多く、抵抗が小 さく、熱伝導が大きい、高感度で即心性の大きな 性能を有する構成となつている。何、この場合に 選定金属としてTi、A l 等を使用するとこれらの 酸化物はミクロ的に多孔性構造を有しており、使 つて、実員的に反応面積の拡大となる。

続いて、勇 2 図(山)に示す如く、 敢 12 図 世 1 3 を 部分 遺元して 触媒 賦 店 1 2 とする。 これ は 酸 程度とすると良い。

次に、第2図(1)に示す如く、加熱処理して破復 屬11を少なくとも部分的に合金化させる。即ち、 800~1.000℃程度の温度で所定時間(30分程 皮)加熱し、少なくとも被復層11と母線10と の境界12近傍を合金化させる。これは加熱によ る各金属元素間の相互拡散に基づく合金化であり、 所望により彼復層11の全体を台金化することも できる。従つて、母帳10と被獲増11とは一体 化され、被復層11内には部分合金が生成される。 被復贈11内に生成される部分台金は上記第1工 程で選定した金属材料によつて異なるが、例えば、 CuZn, CuPd, PtCu, FePt, FePd, Pd3Fe, SnPd、AeCu等がある。この加熱処理は加熱炉 を便用しても良いし、又被後層11を付着形成し た母級10をステム2,2に取り付けた後に通電 加熱する方法で加熱処埋しても良い。尚、加熱処 埋する場合にHe、Ne等の不估性ガスの流れ中で 行なうことが望ましい。この様にして合金化され た仮復順11は母線10との密着性が優れ、熱伝

化物層13は活性化エネルギ状態が高いのでガス 感応性を上げる為に酸化物層13に遮元反応を起 こさせて賦活化、即ち活性化エネルギ状態を低下 させるものである。これは、H2を主成分とする 混合ガス、例えばH2、H2O、HC&、彼量のH2S から成る混合ガスを使用して反応させると良い。

(8)

以上の工程により製造されたガス後知素子は高感度で脚応性が良好であり、又安価に均一な品質のものを製造可能である。又、本発明は上述の特定の実施例に限定されるべきものではなく本発明の技術的配囲を逸脱すること無しに種々の変形例が可能であることは勿論である。向、本発明に基づき製造された系子はカス使知用系子としても使用可能である。

## 4. 凶面の間車な説明

(9)

(符号の説明)

1:カス検知素子

10: 世線

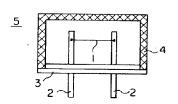
11: 彼 獲 贖

13: 酸化物層

14: 触媒 赋 活化 層

将許出顧人 株式会社 リコー

第1日



第 2 図











(11)

(C) 12 10